Method for cleaning organic electro-luminescent (OEL) display panel and device therefore

Publication number:

TW482698B

Publication date:

2002-04-11

Inventor:

LU TIAN-RUNG (TW); JANG YI (TW)

Applicant:

RITDISPLAY CORP (TW)

Classification:

- international:

B08B7/00; B08B7/00; (IPC1-7): B08B7/00

- European:

Application number:

TW20000107928 20000426

Priority number(s):

TW20000107928 20000426

Report a data error here

Abstract of TW482698B

A method for cleaning an organic electro-luminescent (OEL) display panel comprises performing the following steps on a substrate of an OEL element: wetting the substrate; spraying a cleaning agent and brushing off pollutants with a brush; spraying a high pressure deionized water to remove the residual cleaning agent and the brushed-off pollutants; using a mega-sonic water to remove even smaller pollutants; and drying the substrate by high pressure air or heating. Furthermore, the present invention also discloses a device for cleaning the surface of an OEL element, which comprises a brushing unit; a cleaning agent spraying unit; a water washing unit; a mega-sonic water washing unit; and a drying unit to effectively cleaning the substrate of the OEL element.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 482698

[44]中華民國 91年 (2002) 04月11日

發明

[51] Int.Cl 07: B08B7/00

全 4 頁

稱: 有機電激發光顯示面板之清洗方法及裝置 [54]名

[21]申請案號: 089107928

[22]申請日期:中華民國 89年 (2000) 04月 26日

[72]發明人:

盧添榮

台南市公園路二一七號

台北縣中和市中正路一號十四樓

張毅 [71]申請人:

鉢寶科技股份有限公司

新竹縣竹北市仁義路六十五號

[74]代理人: 吳冠賜 先生

蘇建太 先生 楊慶隆 先生

2

[57]申請專利範圍:

- 1.一種有機電激發光元件之表面清洗方 法,係包括對有機電激發光元件之 面板實施以下步驟:
 - (A)潤濕面板;
 - (B)噴灑清潔劑並以刷子清除污染 物;
 - (C)噴灑水以移除殘餘清潔劑;
 - (D)以混合高超音波(mega-sonic)之水 移除殘餘清潔劑及污染物;以及
 - (E)以高壓空氣吹乾或加熱烘乾基 板。
- 2.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中步驟(D)混合高超音波 (mega-sonic)之水為去離子水。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中高超音波水洗設備之 頻率範圍為 1.2MHz 至 1.8MHz。
- 4.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中該步驟(C)噴灑水以移 除殘餘清潔劑後與步驟(D)以混合高

- 超音波(mega-sonic)之水移除殘餘清 潔劑及污染物更包括步驟(C2)以空氣 回吹面板以除去部分殘餘清潔劑。
- 5.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中該步驟(C)噴灑水以移 除殘餘清潔劑之水為壓力不小於 4Mpa 之水。
- 6.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中該步驟(D)高超音波 (mega-sonic)之水後與步驟(E)以高壓 空氣吹乾或加熱烘乾基板更包括步 驟(D2)噴灑水以移除殘餘清潔劑。
- 7.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中步驟(E)係先將基板以 高壓空氣吹乾基板後再加熱烘乾基 板。
- 8.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中步驟(E)係先將基板加 熱烘乾基板後,再以高壓空氣吹乾 基板。
- 20.

5.

10.

15.

5.

10.

4

- 9.如申請專利範圍第1項所述之表面清 洗方法,其中步驟(E)係以紅外線加 熱爐(IR oven)加熱烘乾基板。
- 10.如申請專利範圍第1項所述之表面 清洗方法,其中步驟(E)以高壓空氣 吹乾或加熱烘乾基板後更包括以紫 外光臭氧處理面板。
- 11.一種有機電激發光元件之表面清洗 裝置,包括:

刷洗單元、清潔劑噴灑單元、水洗 淨單元、高超音波水洗單元、乾燥 單元。

- 12.如申請專利範圍第11項所述之表面 清洗裝置,其中乾燥單元為高壓空 氣乾燥單元。
- 13.如申請專利範圍第11項所述之表面 清洗裝置,其中更包括面板機械傳 送單元。
- 14.如申請專利範圍第11項所述之表面 清洗裝置,其中更包括排氣單元。
- 15.如申請專利範圍第11項所述之表面

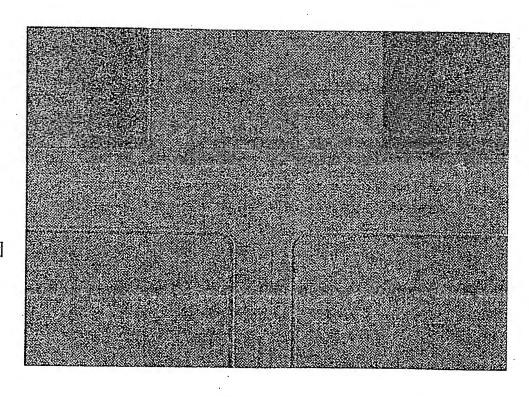
清洗裝置,其中乾燥單元為紅外線 加熱爐(IR oven)。

- 16.如申請專利範圍第11項所述之表面 清洗裝置,其中中音波水洗單元之 為頻率範圍為1.2MHz至1.8MHz。
- 17.如申請專利範圍第11項所述之表面 清洗裝置,其更包含一控制單元。
- 18.如申請專利範圍第11項所述之表面 清洗裝置,其更包含一紫外光臭氧 氧化單元。

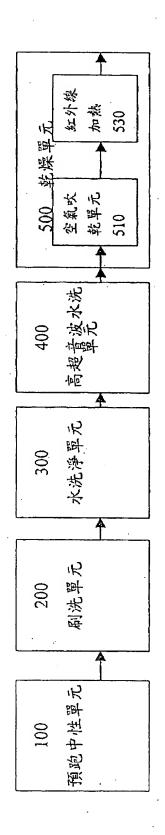
圖式簡單說明:

第1圖係本發明有機電激發光顯 示面板的清洗裝置實施例1之示意 圖。

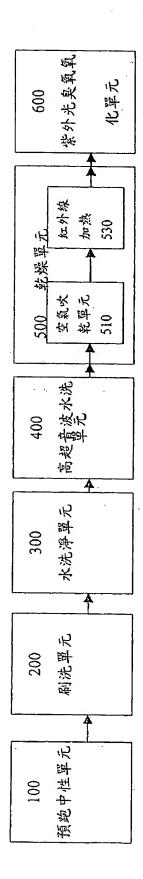
- 15. 第2圖係本發明有機電激發光顯 示面板的清洗裝置實施例2之示意 圖。
- 第3圖係本發明有機電激發光顯 示面板經本發明清洗裝置實施例1之 20. 清洗後之顯微鏡照片圖,其中之斑點 來自顯微鏡之鏡頭。



第3圖



第1圖



第2圖